#### (54) METHOD AND DEVICE FOR DETECTING RELATIVE ANGLE IN TWO-DIMENSIONAL MEASUREMENT BY LASER DISPLACEMENT METER

(43) 15.5.1990 (19) JP

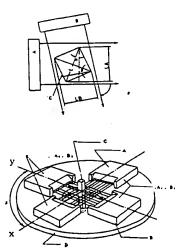
(21) Appl. No. 63-279046 (22) 4.11.1988

(71) TAISEI CORP (72) TAKAHIRO KONDO

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. G01B11/26,G01C15/00,G01M11/00

PURPOSE: To easily and precisely detect a relative angle between crossing optical axes by perpendicularly standing a polygonal prism of high dimension precision in crossing laser optical axes and slowly rotating it to simultaneously measure lengths of parts which intercept respective laser light.

CONSTITUTION: A laser displacement meter A consisting of a light emitting part A, which emits laser parallel rays and a light receiving part A2 which receives them and a laser displacement meter B consisting of a light emitting part B<sub>1</sub> and a light receiving part B<sub>2</sub> are provided on a horizontal substrate D in the X-axis direction and the Y-axis direction and cross each other. A square prism gauge C worked with a high precision is provided as a slowly rotatable bob at the center of crossing between the X axis and the Y axis. The gauge C is slowly rotated, and detection signals received by light receiving parts A<sub>1</sub> and B<sub>1</sub> are converted to electric signals and are converted to data of the length, and this data is sent to a CPU and is operated, and a relative angle  $\theta$  between laser optical axes set in the Y-axis direction and the Y-axis direction is detected.



LA,LB: laser parallel rays, x: X axis, y: Y axis

### (54) LENGTH MEASURING INSTRUMENT BY ELECTRON BEAM

(43) 15.5.1990 (19) JP (11) 2-126108 (A)

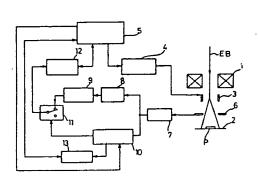
(21) Appl. No. 63-278802 (22) 4.11.1988

(71) JEOL LTD (72) TOSHIHIRO ASARI

(51) Int. Cl5. G01B15/00,H01L21/66

PURPOSE: To measure the width or the like of a pattern with a high precision even at the time of sticking of dust by discriminating whether a detected pattern width is in an allowable value range or not and supplying the detection signal to an addition unit based on the discrimination result.

CONSTITUTION: A scan signal is outputted from a deflector control unit 4 to a deflector 3 by the command from a computer 5, and the scan position of an electron beam EB is moved many times across a pattern P on a sample 2 to perform linear scanning. Reflected electrons from the sample 2 are detected by a detector 6 and are not only stored in a buffer memory 9 but also supplied to a pattern width detecting unit 10. This unit 10 transfers the detection signal stored in the buffer memory 9 to an addition unit 12 when the detected pattern width is in the allowable value range, but the unit 10 transfers the zero signal to the unit 12 when it is not in the allowable value range. After a prescribed number of times of addition in the addition unit 12, the signal of the result is transferred to the computer 5 to measure the pattern width.



1: converging lens, 7: a switching unit, 13: counter 7: amplifier. 8: A/D converter. 11:

# BEST AVAILABLE COPY

(54) LEVEL DISPLAY DEVICE

(43) 15.5.1990 (19) JP

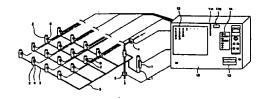
(11) 2-126109 (A) (21) Appl. No. 63-278764 (22) 4.11.1988

(71) TAKENAKA KOMUTEN CO LTD(1) (72) KUNIO FUKUYAMA(2)

51) Int. Cl<sup>5</sup>. G01B21/00,E02D27/34,E02D35/00

PURPOSE: To easily and accurately display a relative level difference measured at each measurement position by displaying a relative displacement difference between the level in each measurement position and a reference level on a level display means arranged in positional relations correspond to the measurement position.

CONSTITUTION: A reference manometer 1 installed in a reference position of a structure and many manometers 2 installed in respective measurement positions are connected to each other by connection tubes 3. The liquid surface level is detected by a liquid surface sensor 7 of the reference manometer 1 and is displayed on a bar graph 11A and a digital meter 11B of a display device 10. Each displacement manometer 2 is provided with a sensor 8 which generates the output when the liquid surface reaches a prescribed level, and plural lamps 12 arranged in positional relations to respective measurement positions are lit. The liquid surface level displayed on the bar graph 11A or the digital meter 11B at the time of lighting of one lamp 12 indicates the difference in level between the measurement position where the displacement manometer 2 corresponding to this lamp 12 is installed and the position where the reference manometer 1 is installed.



⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

## ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-126108

fint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

码公開 平成2年(1990)5月15日

G 01 B 15/00 H 01 L 21/66 B 8304-2F J 7376-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

50発明の名称

電子ピーム測長装置

②特 顧 昭63-278802

20出 顧 昭63(1988)11月4日

⑩発明者 浅

敏 弘

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号 日本電子株式会社内

⑪出 願 人 日本電子株式会社

東京都昭島市武蔵野3丁目1番2号

個代 理 人 弁理士 井島 藤治 外1名

利

明細細

1. 発明の名称

電子ピーム測長装置

- 2、特許請求の範囲
- (2) パターン幅が許容値内の直線状走査の回数

をカウントするカウンタを設けた請求項 1 記載の電子ビーム測長装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、半導体デバイス等の製作の過程でシリコンウエハ等の上に形成されたパターンの幅等 を電子ビームを使用して削長するようにした電子 ビーム削長装置に関する。

(従来の技術)

電子ピーム測長装置では、試料上の測長すべきパターンを誘切って電子ピームを直線状に走査し、この走査に伴って得られた反射電子等の情報信号を検出し、検出信号に基づいてパターンの幅を測長している。通常、検出信号のSN比を高めるために直線状の電子ピーム走査を多数回行い、得られた多数の検出信号を加算するようにしている。この場合、電子ピーム照射による試料のダメージを小さくし、コンタミネーションの発生の防止やチャージアップによる電子ピームのゆらざの影響を少なくするために、移動加算測長方式が採用さ

れている。第3図はこの方式を示しており、被別 長パターンPを機切って電子ピームの直線状走査 Sぃ〜S。が行われる。この電子ピームの直線状 走査は少しずつ走査位置を、ずらしながら行われ、 を走査に基づいて検出された、例えば、反射電子 信号は加算される。第4図は検出信号強度を取り、Dぃは走査Sぃに対応したもの、Dぃは走査づく検出信号を加算したもの、D。は「回の走査に基づいて得られた検出信号を加算したものである。この加算信号 D。に基づいてパターンPの幅が測長される。

このように、移動加算測長方式では、試料の同一位置で多数回の電子ピームの走査が行われないので、試料のダメージを少なくでき、又、コンタミネーションの発生を防止でき、更に、試料がチャージアップすることも防止できる。

#### (発明が解決しようとする課題)

ところで、第5図に示すように、パターンPの 上にゴミBがあると、次のような問題が生じる。 すなわち、ゴミBが存在しないパターン部分の走

試料上での電子ピームの走査に伴って得られた情報信号を検出する検出器と、1回の直線状走査による検出器の出力信号に基づいてパターン幅を分からの信号に基づいて許容値以内、というかを検出するパターン幅検出ユニットとを確えて、検出ユニットとを確えて、クーンをはかいまって、検出コニットには加算ユニットに検出であれば加算ユニットに検出であればからの特別によって、検出されたパターンを供給し、検出されたパターンを開発して、検出されたパターンを開発して、検出されたパターンを開発したことを特徴としている。

請求項2の発明に基づく電子ビーム測長装置は、 請求項1の発明の構成に加えて、パターン幅が許 容値内の直線状走査の回数をカウントするカウン タを設けたことを特徴としている。

#### (作用)

請求項1の発明では、各直線状の走査に基づいて検出されたパターン幅が予め設定した許容値以内であれば、その検出信号を加算することとし、そのパターン幅が許容値外であれば、検出信号を

查5。による検出信号は、第6図(a)に示すようになるのに対し、ゴミBの存在している部分の走査S。に基づく検出信号は、第6図(b)のように走査S。に基づく信号と比べると幅が広くなっている。このような検出信号を加算すると、第6図(c)に示すように、パターンにゴミが付着しているのに対し、ゴミの付着したパターンの他方の端部に基づくピークE₂は鋭くの他方の端部に基づくピークE₂は別定されたパターンの幅は、正確とならず、かなり測定精度が悪化する。

本発明はこのような点に鑑みてなされたもので、 その目的は、ゴミが付着していても、正確に高精 度でパターンの幅等の測長を行うことができる電 子ピーム測長装置を実現することにある。

#### (課題を解決するための手段)

請求項1の発明に基づく電子ビーム測長装置は、電子ビームを試料上で直線状に走査すると共に、 試料上の直線状走査位置をずらすための手段と、

加算せず、パターン幅の演算を許容値内のパターン幅となった直線状走査によって得られた検出信号を加算した信号に基づいて行う。

請求項2の発明では、請求項1の発明に加えて、 許容値以内のパターン幅となった直線状走査の回 数をカウントし、そのカウント値からパターン欠 陥の程度を知る。

#### (実施例)

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に 説明する。第1図は本発明に基づく電子ピーム制 長装置の一実施例を示しており、電子ピームEB は、収束レンズ1によってパターンPが形成され た被測長試料2上に細く収束されると共に、電子 ピームEBの照射位置は、酢電偏向器3によって 変えられる。静電偏向器3には、偏向器制御ユニット4から電子ピーム走査信号が供給されるが、 偏向器制御ユニット4は、コンピュータ5によって が知道される。

試料2への電子ビームEBの照射に基づいて発生した反射電子は、反射電子検出器6によって検

出される。検出器6の検出信号は、増幅器7によって増幅され、A/D変換器8を介してバッファメモリ9とパターン幅検出ユニット10に供給される。パッファメモリ9に記憶された信号は、スイッチング回路11に供給されるが、スイッチング回路11に供給されるが、ト10からの信号によってパッファメモリ9に記憶された信号かあるいはゼロ信号を加算ユニット10からの信号をカウントするカウンタであり、カウント値はコンピュータ5に供給される。

このような構成の装置の動作は次の通りである。まず、コンピュータ5からの指令により、加算ユニット12とカウンタ13の値がクリアされ、、第5図に示す測長すべきパターン幅検出ユニット2を動の許容幅W、とがパターン幅検出ユニット10にセットされる。次に、コンピュータ5から偏向器制御ユニット4に走査開始信号が出力され、試料2上のパターンPを横切って多数回、電子ビー

ムEBを直線状に走査する走査信号を発生し、偏向器3に供給する。この結果、第5図に示すような走査位置を移動させながらの電子ビームの直線状走査が行われる。

試料2への電子ビームの照射に基づいて発生し た反射電子は検出器6によって検出されるが、こ の検出信号はパッファメモリ9に供給されて記憶 されると共に、パターン幅検出ユニット10に供 給される。第2図は1回の電子ビームの直線状走 査に基づいて検出された信号を示しており、この 信号がパッファアンプタに記憶され、そしてパタ ーン幅検出ユニット10に供給される。パターン 幅検出ユニット10では、信号のスレッショルド レベルしより高い信号のうちのピーク位置 A. B を認識し、このユニットの内部に設けられた2つ のカウンタに夫々の位置を記憶する。このA、B 2つの値の差がパターン幅となるので、パターン 幅検出ユニット10は、内部のカウンタの値の差 を求め幅Wを求める。更に、このユニット10で は、設計値W。と検出幅Wとの差が許容値W。以

上か以内かを判断する。すなわち、

 $| W_0 - W | \leq W.$ 

の時、パターン検出ユニット10はスイッチング ユニット11を制御し、パッファメモリ9に記憶 されている1回分の直線状走査に基づく検出信号 を加算ユニット12に転送する。一方、

 $| W_{\circ} - W | > W$ .

の時、パターン検出ユニット10はスイッチング ユニット11を制御し、加算ユニット12には、 パッファメモリ9に記憶されている信号に代えて、 ゼロ信号を転送する。更に、パターン幅検出ユニ ット10は、パターン幅が許容値以内の時にカウ ンタ13のカウント値をアップさせる。

このように、加算ユニット12には、パターン 幅が許容値以内の信号のみが供給されて加算され る。電子ピームの直線状走査が所定の回数(n回) 終了したら、加算ユニット12において加算され た信号はコンピュータ5に転送され、その加算信 号に基づいてパターンの幅が測長される。この加 算信号は、ゴミが付着した部分の信号が除去され たものであるため、第4図の n 回累計加算信号と ほぼ等しい信号被形となり、正確な測長が可能と なる。

なお、カウンタ13には、パターン幅が許容値 内に入った直線状走査(ラスタ)の数がカウント されているので、 n 回走査してm 回成功した場合、 m / n により、パターンが全体として設計値通り の幅か否か等のパターンのチェックを行うことが できる。

以上本発明を説明したが、本発明はこの実施例に限定されない。例えば、反射電子を検出するようにしたが、2次電子を検出するようにしても良い。

#### (発明の効果)

以上説明したように、請求項1の発明では、ゴミが付着していると考えられる部分からの信号を 幅測長のための信号加算から除去するようにした ので、ゴミの影響をなくして高精度の測長を行う ことができる。

又、請求項2の発明では、パターンの幅が許容

値以内の走査回数をカウントするようにしたので、 パターンが欠陥かどうのチェックを行うことがで きる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の一実施例である電子ピーム 削長袋置を示す図、第2図は、検出信号故形を示 す図、第3図は、移動加算測長方式を説明するた めの図、第4図は、加算信号を示す図、第5図は、 ゴミの付着したパターンにおける電子ピームの走 査の様子を示す図、第6図は、第5図の走査によ る検出信号波形を示す図である。

1…収束レンズ

2 … 試料

3…偏向器

4…偏向器制御ユニット

5…コンピュータ

6 … 検出器

7…增幅器

8 ··· A / D 変換器

9 … パッファメモリ

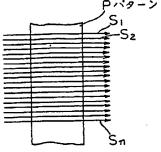
10…パターン幅換出ユニット

11…スイッチングユニット・

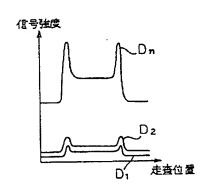
12…加算ユニット 13…カウンタ

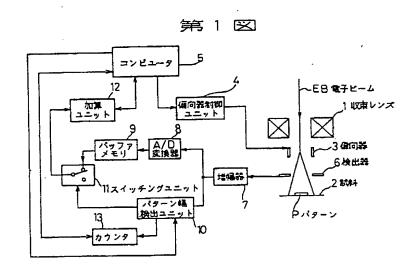


第 3 図

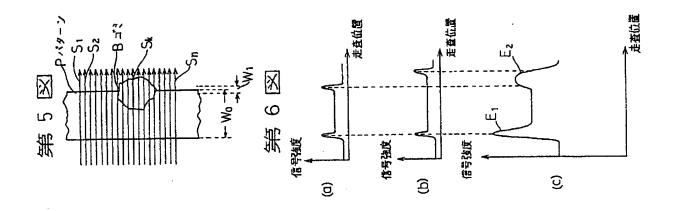


第 4 図





第 2 図 信号强度 走管位置



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.